## 國立交通大學電子工程學系電子研究所碩士班碩士論文

有機添加劑和改變稀釋比例之 化學機器研磨

Cu-CMP with Organic Additive and W-CMP with Different Dilution Ratio

研究生:洪啟哲

指導教授:葉清發 教授

中華民國九十四年七月

## 有機添加劑和改變稀釋比例之化學機器研磨

## **Cu-CMP** with Organic Additive and

## W-CMP with Different Dilution Ratio

研究生:洪啟哲 Student: Chi-Che Hong

指導教授: 葉清發教授 Advisor: Dr. Ching-Fa Yeh

蔡明蒔博士 Dr. Ming-Shih Tsai

國立交通大學

電子工程學系 電子研究所碩士班

碩士論文 ES A Thesis

Submitted to Department of Electronics Engineering

& Institute of Electronics Engineering and Computer Science

National Chaio Tung University

in Partial Fulfillment of Requirements

for Degree of Master of Science

in Electronics Engineering

June 2005

Hsinchu, Taiwan, Republic of China

中華民國九十四年七月